

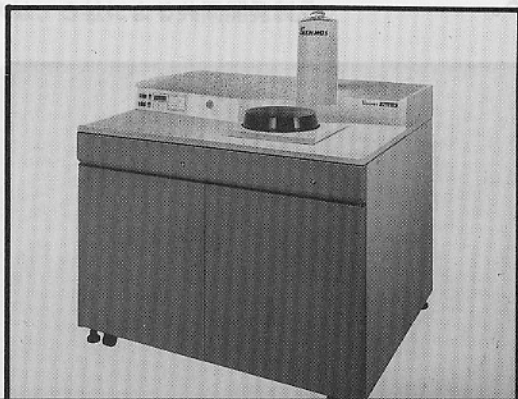
入賞

(株) テクノス

全反射蛍光X線は、非破壊かつ短時間分析が可能ということで、4～5年前から半導体ウェハーの表面汚染分析法として注目されてきたが、感度の点では十分でなかった。

本装置は、感度向上のために励起源を従来の封入管から独自に開発した高出力回転対陰極X線源を用い、S/N比を向上するためにモノクロメーターを用いることにより、検出限界値を飛躍的に向上させている。

非破壊かつ短時間分析が高感度で行えることから、インライン検出が可能となったので、今後、ディスクや液晶の分野への応用も期待される。



全反射蛍光X線分析装置
「TREX610T」